日刊工業新聞

年月日	16	03	22	ページ	03	NO.	

凛としていきる

理系女性の挑戦

手を抜かず、無理しすぎず

次世代露光技術の開発

半導体製造におけるリソグラフィ（露光）プロセスの開発に従事してきた。微細な回路パターンを高い歩留まりで刻むために、膨大なシミュレーションを繰り返して最適な設計・露光条件・原版形状などを求める工程が必要であり、この計算機リソグラフィと呼ばれる技術を担当。現在は次世代露光技術の開発にも携わり、日々難題に取り組んでいる。

修士では生命工学を学び、全く異なる分野に就職したが、身につけた研究の手法はそのままプロセス開発に活かすことができた。初めての海外国際学会での発表では、上司をはじめ周囲の方々がこぞって指導・育成してくださった。恵まれた環境だったが、デバイス開発計画や景気の動向に翻弄（ほんろう）される日々でもあった。

サンノゼの国際学会にて座長を務めた

30代後半に上司から社会人博士課程に挑戦しないかと言われ、迷わず手を挙げた。入学後は子供を寝かしつけた後にひっそりデスクライトで論文を執筆する日々。査読つき論文を書き溜（た）め、博士論文は教授に厳しく指導いただき、学位を取得することができた。その後は社内外の依頼があり、国際学会の委員・座長、半導体関連委員会の委員などをお受けしてきた。若い方々にも、機会があればぜひ挑戦をしてほしい。きっと世界が広がり、一歩を踏み出す自信につながるはずだ。

今では子供たちも成長し、夕飯を用意してくれるまでになり感無量であるが、ここまでの道のりは険しかった。1人目は産後半年で復職したが、配偶者の中東単身赴任が重なり、仕事と子育ての両立に必死で余裕のない生活であった。2人目は産休のみ8週間で復職。ベビーシッターを活用し、海外出張の時は双方の両親に助けを求めながら、綱渡りで乗り切った。夜遅くまでの会議を終えて帰宅すると、待ちくたびれた子供の寝顔には涙の跡。仕事の成果を挙げるために最大限の努力を重ねてきたが、いつも悩みの種は、バランスのとり方であった。種々のサポート環境を享受しつつ、欲張って無理をしていないか、という葛藤である。

ここで相談できる「斜めの関係」が貴重であった。家族と周囲の支えに感謝しつつ、今後も「決して手を抜かず、無理しすぎず」で引き続き技術の発展に寄与していきたい。

企画協力・日本女性技術者フォーラム（JWEF）

（火曜日に掲載）

東芝セミコンダクター&ストレージ社 半導体研究開発センター 主査
小林（こばやし） 幸子（さちこ）

〈プロフィル〉94年東大院工学系研究科工業化学専攻修了、東芝＊入社。先端半導体リソグラフィプロセス開発に従事。博士（工学）。＊JWEF法人会員。

無断転載・複写禁止©㈱日刊工業新聞社